

京都大学大学院工学研究科附属光・電子理工学教育研究センター／電気電子デジタル理工学専攻
フォトリック結晶面発光レーザー形成設備共同利用規程

令和5年10月12日
工学研究科長裁定制定

(趣旨)

第1条 この規程は、京都大学大学院工学研究科附属光・電子理工学教育研究センター、電気電子デジタル理工学専攻量子機能工学講座光量子電子工学分野（以下「分野等」という。）が管理及び運用する設備の共同利用について必要な事項を定めるものとする。

(設備)

第2条 この規程において対象となる設備は、別表に掲げる設備（以下「設備」という。）とする。

(管理責任者)

第3条 設備の適正な管理を行うため、設備ごとに管理責任者を置き、分野等の教員のうちから分野等の代表者が選任する。

(利用資格)

第4条 設備を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

- (1) 京都大学（以下「本学」という。）の教職員又は学生のうち、分野等に所属するものでフォトリック結晶面発光レーザーに関わる研究開発を目的に使用するもの
- (2) 本学の教職員又は学生のうち、前号以外のものでフォトリック結晶面発光レーザーに関わる研究開発を目的に使用するもの
- (3) 国、地方公共団体、国立大学法人若しくは大学共同利用機関法人、独立行政法人又は教育・研究を事業目的とする法人若しくは団体に所属する者でフォトリック結晶面発光レーザーに関わる研究開発を目的に使用するもの
- (4) 企業等において研究開発に従事する者でフォトリック結晶面発光レーザーに関わる研究開発を目的に使用するもの
- (5) その他管理責任者が適当と認める者

(利用日)

第5条 設備は、次の各号に掲げる日を除き、毎日利用できる。

- (1) 日曜日及び土曜日
- (2) 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日
- (3) 12月29日から翌年1月3日まで（前号に掲げる日を除く。）
- (4) 6月18日（創立記念日）
- (5) 8月第3週の月曜日、火曜日及び水曜日

2 前項の規定にかかわらず、管理責任者が特に必要と認めるときは、前項各号に掲げる日の利用を許可し、又は利用可能な日であっても利用を禁止することがある。

(利用時間及び利用単位)

第6条 設備の利用時間は、午前10時から午後6時までとする。

2 設備の利用単位は、1時間とする。

3 第1項の規定にかかわらず、管理責任者が特に必要と認めるときは、利用時間を延長し、又は短縮することがある。

(利用申請)

第7条 設備を利用しようとする者は、当該設備を利用しようとする日（複数日に連続してまたがる場合はその最初の日）の6か月前から14日前までに、本学の設備サポート拠点である「桂結」－最先端研究機器の進化するネットワーク拠点（以下「桂結」という。）におけるウェブシステムを通じて利用申請を行い、事前に承認を受けなければならない。

（利用承認）

第8条 管理責任者は、前条により利用申請があったときは、その承認又は不承認を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

2 設備の利用承認を受けた者（以下「利用者」という。）は、利用日時を変更し、又は利用を取り止める場合には、承認を受けた利用予定日（複数日に連続してまたがる場合はその最初の日）から起算して14日前までに管理責任者に申し出て、その承認を受けなければならない。申出の期日を経過した場合は、設備の利用日時の変更又は利用の取止めを申し出ることができない。

（利用料）

第9条 利用者は、本学の指定する方法により、別表に定める利用料を納付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、管理責任者が特別の理由があると認めるときは、利用料の全部又は一部を免除することができる。

3 一旦納付された利用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用料の全部又は一部を返還する。

(1) 前条第2項に定める利用日時の変更又は利用の取止めを承認した場合

(2) 分野等の都合により承認を取り消し、又は設備の利用を停止させた場合

（利用者の遵守事項）

第10条 利用者は、設備の利用に関し、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用を承認された目的以外に利用しないこと。

(2) 設備を第三者に利用させないこと。

(3) 設備を初めて利用する場合は、管理責任者が実施する事前講習を受講すること（管理責任者が不要と認める場合を除く。）。)

(4) 設備に特別の工作をし、又は現状を変更しないこと（管理責任者が認める場合を除く。）。)

(5) 分野等の施設、設備等の保全に努めること。

(6) その他管理責任者が指示する事項

2 利用者は、設備に異常があるときは、速やかに管理責任者に報告し、その指示に従わなければならない。

（利用の停止）

第11条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第8条第1項における設備の利用の承認を取り消し、又は設備の利用を停止させることができる。

(1) 利用者が、この規程に違反し、又は違反するおそれがあると管理責任者が認めるとき。

(2) 利用者が、利用申請において虚偽の記載をしたとき。

(3) 利用者が、利用料を本学が指定する期日までに納付しないとき。

(4) 本学の管理上の事由により設備の利用に支障があると管理責任者が認めるとき。

2 前項第1号から第3号までの事由により設備の利用の承認を取り消し、又は設備の利用を停止させたことにより利用者に損害を及ぼすことがあっても、本学はその責めを負わない。

（原状回復）

第12条 利用者は、設備の利用を終えたとき（前条第1項の規定により利用承認を取り消し、又は利用を停止した場合を含む。）は、速やかに原状に回復するとともに、管理責任者の検査

を受けなければならない。ただし、管理責任者が不要と認めたときは、この限りでない。

(損害賠償)

第13条 利用者は、その責に帰すべき事由により分野等の施設、設備等を滅失又は毀損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(免責)

第14条 分野等は、利用者に設備の利用機会を提供するものであって、有意な結果を保証するものではない。

(発明等の帰属)

第15条 利用者は、設備の利用の結果を用いたことによって京都大学発明規程（平成16年達示第96号）第2条第1号に定める発明等が生じた場合は、管理責任者に届け出るものとする。

2 管理責任者は、発明等が生じた場合の当該発明等の知的財産権の取扱いについては、利用者と別途協議し、書面にて定めるものとする。

3 前項の規定は、設備の利用の過程において作成された研究成果有体物の取扱いについて準用する。

(秘密保持)

第16条 分野等に所属する教職員及び利用者は、次の各号のいずれかに該当するものを除き、設備の利用に関連して知り得た一切の情報を、相手方の書面による事前の同意なしに第三者に開示し、又は漏えいしてはならない。

- (1) 既に公知となっている情報
- (2) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
- (3) 相手方から当該情報を入手した時点で、既に自己が保有していた情報
- (4) 相手方から知り得た情報によらず、自己が独自に開発した情報
- (5) 相手方から当該情報を入手後、自己の責めによらずして公知となった情報
- (6) 裁判所、行政機関等の公的機関から法令に基づき開示を命ぜられた情報

(事務)

第17条 設備の利用に関する事務は、桂地区（工学研究科）事務部において処理する。

(疑義等の解決)

第18条 この規程に定めのない事項が生じた場合又は解釈に疑義が生じた場合は、その都度管理責任者及び利用者が協議の上、解決に努めるものとする。

(規程の変更)

第19条 工学研究科長は、以下の場合に利用者の同意を得ることなくこの規程を変更できるものとする。

- (1) 規程の変更が、利用者の一般の利益に適合するとき。
 - (2) 規程の変更が、契約の目的に反せず、かつ、設備管理上の必要性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
- 2 前項による規程の変更にあたり、規程を変更する旨及び変更後の規程の内容並びにその効力発生日を、効力発生日までに「桂結」ホームページへの掲示又は電子メールによる通知その他の適切な方法により、利用者に周知するものとする。

(その他)

第20条 この規程に定めるもののほか、設備の共同利用に関し必要な事項は、管理責任者が定める。

附 則

この規程は、令和5年10月12日から施行する。

附 則

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

別表（第2条、第9条関係）

設備名称	利用単位	(上段) 利用料単価 (単位: 円)			
		(下段) 事前講習料 (単位: 円)			
		第4条第1号 に掲げる者	第4条第2号 に掲げる者	第4条第3号 に掲げる者	第4条第4号 に掲げる者
半導体結晶成長装置 太陽日酸(株)製 HR-3216	1時間あたり	0	25,400	36,300	36,300
	1回あたり (初回利用時)	0	58,400	83,500	83,500
プラズマCVD装置 サムコ(株)製 PD-220	1時間あたり	0	7,400	10,600	10,600
	1回あたり (初回利用時)	0	23,200	33,100	33,100
電子ビーム露光装置 日本電子(株)製 JBX-6300 等	1時間あたり	0	23,000	32,800	32,800
	1回あたり (初回利用時)	0	108,600	155,100	155,100
電子ビーム露光装置 日本電子(株)製 JBX- 9400#1等	1時間あたり	0	37,100	53,000	53,000
	1回あたり (初回利用時)	0	165,200	235,900	235,900
電子ビーム露光装置 日本電子(株)製 JBX- 9400#2等	1時間あたり	0	42,000	60,000	60,000
	1回あたり (初回利用時)	0	184,700	263,800	263,800
プラズマエッチング装置 サムコ(株)製 RIE-41iPK	1時間あたり	0	8,200	11,700	11,700
	1回あたり (初回利用時)	0	49,400	70,600	70,600
プラズマエッチング装置 サムコ(株)製 ICP- 110iPKU	1時間あたり	0	8,200	11,700	11,700
	1回あたり (初回利用時)	0	49,400	70,600	70,600
プラズマエッチング装置 サムコ(株)製 RIE-200ku	1時間あたり	0	8,000	11,500	11,500
	1回あたり (初回利用時)	0	48,700	69,600	69,600
プラズマエッチング装置 サムコ(株)製 RIE-200kuS	1時間あたり	0	8,100	11,500	11,500
	1回あたり (初回利用時)	0	48,800	69,700	69,700
プラズマエッチング装置 サムコ(株)製 RIE- 400iPNK	1時間あたり	0	10,000	14,300	14,300
	1回あたり (初回利用時)	0	56,600	80,900	80,900
反応性イオンエッチング装 置 サムコ(株)製 RIE-10NR-KU	1時間あたり	0	2,800	4,000	4,000
	1回あたり (初回利用時)	0	7,000	10,000	10,000
走査型電子顕微鏡 (株)日立ハイテクノロジー ズ製 S-4800EDX	1時間あたり	0	6,800	9,700	9,700
	1回あたり (初回利用時)	0	22,000	31,400	31,400

設備名称	利用単位	(上段) 利用料単価 (単位: 円)			
		(下段) 事前講習料 (単位: 円)			
		第4条第1号 に掲げる者	第4条第2号 に掲げる者	第4条第3号 に掲げる者	第4条第4号 に掲げる者
走査型電子顕微鏡 (株)日立ハイテク製 Regulus8220	1時間あたり	0	7,500	10,700	10,700
	1回あたり (初回利用時)	0	23,400	33,400	33,400
光露光装置 (株)ナノシステムソリュー ションズ製 DL-1000KIR	1時間あたり	0	6,600	9,400	9,400
	1回あたり (初回利用時)	0	19,600	27,900	27,900
光露光装置 ネオアーク(株)製 DDB- 701-DL4-FBT 等	1時間あたり	0	2,900	4,100	4,100
	1回あたり (初回利用時)	0	12,200	17,400	17,400
電子ビーム蒸着装置 (株)サンバック製 ED-1500	1時間あたり	0	7,300	10,400	10,400
	1回あたり (初回利用時)	0	22,100	31,600	31,600
電子ビーム蒸着装置 (株)サンバック製 多元同 時電子ビーム蒸着装置	1時間あたり	0	5,500	7,900	7,900
	1回あたり (初回利用時)	0	18,700	26,600	26,600
メッキ装置 (株)日立パワーソリューシ ョンズ製 大面積フォトニ ック結晶レーザー用厚膜電 極形成装置	1時間あたり	0	8,500	12,100	12,100
	1回あたり (初回利用時)	0	23,300	33,300	33,300
研削・研磨装置 スピードファム(株)製 FAM-12BS#1	1時間あたり	0	4,200	6,000	6,000
	1回あたり (初回利用時)	0	7,400	10,600	10,600
研削・研磨装置 スピードファム(株)製 FAM-12BS#2	1時間あたり	0	4,100	5,900	5,900
	1回あたり (初回利用時)	0	7,300	10,400	10,400
ダイシング装置 (株)ディスコ製 純水リサ イクルユニット付きダイシ ング装置	1時間あたり	0	6,500	9,300	9,300
	1回あたり (初回利用時)	0	9,800	13,900	13,900
スクライブ装置 ダイトロンテクノロジー (株)製 DPS-301R-KU	1時間あたり	0	2,200	3,200	3,200
	1回あたり (初回利用時)	0	6,400	9,200	9,200
フリップチップボンディング 装置 ハイソル(株)製 MODEL4200-KU	1時間あたり	0	7,400	10,500	10,500
	1回あたり (初回利用時)	0	22,400	32,000	32,000

設備名称	利用単位	(上段) 利用料単価 (単位: 円)			
		(下段) 事前講習料 (単位: 円)			
		第4条第1号 に掲げる者	第4条第2号 に掲げる者	第4条第3号 に掲げる者	第4条第4号 に掲げる者
フリップチップボンディング装置 ハイソル(株)製 KMP400	1時間あたり	0	7,900	11,200	11,200
	1回あたり (初回利用時)	0	23,300	33,300	33,300
ワイヤボンディング装置 米国ウエスト・ボンド社製 モデル 7476D	1時間あたり	0	1,100	1,600	1,600
	1回あたり (初回利用時)	0	4,900	7,000	7,000
ワイヤボンディング装置 米国ウエスト・ボンド社製 モデル 4KE	1時間あたり	0	2,200	3,100	3,100
	1回あたり (初回利用時)	0	6,000	8,600	8,600
封止装置 (株)ハイマックス製 イン バータ式溶接機	1時間あたり	0	3,100	4,400	4,400
	1回あたり (初回利用時)	0	6,900	9,900	9,900

1. 上記表中上段の利用料単価は、利用単位あたりの設備利用に係る金額（消費税相当額を含む。）であり、これに利用単位数を乗じた金額に下段の事前講習料を加えた金額を利用料とする。
2. 1時間未満の設備利用及び1時間を超える設備利用に係る1時間未満の端数については、それぞれ1時間の設備利用として、利用料を算出するものとする。
3. 第4条第5号に掲げる者の利用料単価及び事前講習料は、当該者の所属、身分等を勘案のうえ、管理責任者が指示するものとする。